(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-135177

(43)公開日 平成7年(1995)5月23日

(51)	Int	C1 5	
(31)	1116	UI.	

## 識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/203

M 8122-4M

C 2 3 C 14/24

D 9271-4K

C 3 0 B 23/08

M

# 審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-302173

(22)出願日

平成5年(1993)11月9日

(71)出顧人 000003942

日新電機株式会社

京都府京都市右京区梅津高畝町47番地

(72)発明者 大橋 茂治

京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 日

新電機株式会社内

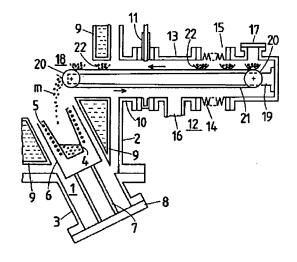
(74)代理人 弁理士 成田 擴其

## (54) 【発明の名称】 材料供給装置

### (57)【要約】

【目的】 成膜室の材料供給箇所に対し、任意の方向から材料を供給できるようにすること。

【構成】 成膜室に取付けた分子線セル1上方のボート 10に、仕切りバルブ11を介し、伸縮機構14を持つ伸縮可能の材料供給室12を取付ける。材料搬送機構18の循環移動する搬送ベルト21に、材料を入れる複数のボート22を固定する。材料供給室を伸長し、材料搬送機構を収納し、仕切りバルブを閉じ、供給室を大気圧に戻す。ベルトを動かし、各ボートに投入口17から材料を入れ、供給室を真空排気し、仕切りバルブを開く。材料供給室を押縮し、材料搬送機構の先端部をるつぼ4の上に位置させ、ベルトを動かし、ボートをるつぼの上で反転させて材料mをるつぼに落す。任意角度のベルトに対し、ボート底部の取付位置を変えることにより、ボート搬送時、ボートは水平に保たれる。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 仕切りバルブを介して成膜室のポートに 取り付けられ、材料投入口を有する伸縮可能の材料供給 室と、循環移動する搬送ベルト及びこのベルトに固定さ れた材料を入れる複数のボートを有し、前記材料供給室 に取り付けられた材料搬送機構とを備えてなることを特 徴とする材料供給装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

成装置、特に分子線エピタキシー装置に適する材料供給 装置に関する。

### [0002]

【従来の技術】薄膜形成装置、真空蒸着装置に係る分子 線エピタキシー(MBE)装置にあっては、所要の材料 の蒸発源である分子線セル (クヌードセンセル) が成膜 (成長)室となる真空チャンバに取り付けられており、 分子線セルのるつぼから飛び出た分子 (原子)線を被成 膜基板に到達させ、所望の結晶を成長させている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】装置の運転に伴い、る つぼ内の蒸発材料がなくなると、材料を補給しなければ ならない。単純には、真空チャンバを大気圧に戻し、分 子線セルを取り外して、るつぼに材料を入れればよい が、この場合、再び真空チャンバ内を超高真空(10-9 ~10-11Torr) に排気して装置の運転が行える状態に するには、かなりの日数、手間がかかる。

【0004】また、分子線セルのるつぼに対する材料供 給装置を真空チャンパに設けたものもあり、図3

子線セルのるつぼ31は成膜室である真空チャンバ32 の底部ないし側面部に成膜室内に突き出る形で設けられ ており、材料供給時、真空チャンバの側面部、上部に形 成されたポートを通して材料供給管33、或いは材料供 給柄杓34をるつぼ31の開口部上に斜め上から、或い は上方から位置させ、るつぼに材料を入れている。

【0005】しかし、特にMBE装置における成膜室の 側面部及び上部にはかなりの数のポートがあり、それら は外部からの運転操作に重要な部分となっている。した がって、成膜室に突き出る形で取り付けられている分子 40 により結合している。固定部12には真空排気システ 線セルのるつぼに対し、従来のように斜め上から、或い は上方からしか材料が供給できない構造の機構では、そ の取付けが不可能となったり、取付けることができる機 構数が制限される場合が出てくる。

【0006】本発明は、成膜室の材料供給箇所に対し、 上から、横から、或いは下からと、任意の方向から材料 の供給を行うことができる装置の提供を目的とするもの である。

### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明の材料供給装置

は、仕切りバルブを介して成膜室のポートに取り付けら れ、材料投入口を有する伸縮可能の材料供給室と、循環 移動する搬送ベルト及びこのベルトに固定された材料を 入れる複数のボートを有し、前記材料供給室に取り付け られた材料搬送機構とを備えてなることを特徴とするも のである。

2

## [0008]

【作用】材料収容ボートに材料を入れるとき、材料供給 室を伸長させて循環搬送ベルト機構を同室内に収容し、 【産業上の利用分野】本発明は、真空蒸着装置、薄膜形 10 仕切りバルブを閉じ、同室内を大気圧に戻す。材料投入 口を開けて、材料収容ボートに材料を入れ、材料供給室 を真空排気する。成膜室のるつぼに材料を供給すると き、仕切りバルブを開き、材料供給室を押縮して搬送べ ルト機構の先端部を成膜室内の材料供給箇所、るつぼ上 に位置させ、搬送ベルトを移動させて材料収容ボートを 反転させることにより、ボート内の材料をるつぼに落下 させる。搬送ベルトの搬送角度に応じて、搬送ベルトに 対する材料収容ボートの取付角度を変えることにより、 成膜室の所要の箇所、るつぼに任意の方向から材料を供 20 給できる。

#### [0009]

【実施例】本発明の実施例について図面を参照して説明 する。図1はMBE装置に適用した実施例の断面構成図 である。分子線セル1は成膜室を形成する真空チャンバ 2に設けた分子線セル・ポート3に取り付けられてい る。分子線セル1のるつぼ4の周囲にはるつぼヒータ5 が設けられており、これらを熱シールド部材6が囲み、 分子線セル全体は支持部材7を介して分子線セル・ボー ト3の閉塞部材8に取り付けられている。分子線セル1 (a),(b)にその材料供給態様の説明図を示す。分 30 の周囲等、真空チャンバ2の内部には液体窒素で冷却さ れたシュラウド9が設けられており、チャンバ内の不 純、不要ガスを捕捉している。

> 【0010】真空チャンバ2における分子線セル1の取 付け部より上方のポート10に、るつぼ4への材料供給 機構を取り付ける。同ポートに、仕切りバルブ(ゲート バルブ) 11を介して伸縮可能の材料供給室12が取り 付けられ、同供給室は、仕切りバルブに結合する固定部 13、ベローズ等の伸縮機構14を有し、端部が閉塞さ れている可動部15からなり、これら各部分はフランジ ム、大気圧リークシステムに連通する排気ポート16が 形成されており、可動部15の上部に材料投入口17が 設けられている。

【0011】伸縮機構14を伸ばし、伸長した材料供給 室12内に収納される材料搬送機構18は、支持アーム 19に軸支された一対のローラ20、これらローラに掛 け渡された搬送ベルト21及び同ベルトに固定された複 数の材料を入れるボート22からなり、支持アームは可 動部15の端部に取り付けられている。ボート22は半 50 球、椀ないし深皿状のものであり、図1では水平に動く

搬送ベルト21に対し、ボートの底の中央部をベルトに 固定することにより、材料がこぼれないようにボートも 水平に保たれる。一対のローラ20の何れか一方を材料 供給室12の外部から、或いは同供給室内に設けた駆動 機構で回転させることにより搬送ベルト21を矢印方向 に循環移動させ、ボート22を移動させる。

【0012】ボート22に材料を入れるとき、材料供給 室12の伸縮機構14を伸ばし、同供給室を伸長させて 材料搬送機構18を同供給室内に収納する。仕切りバル 開けて材料供給室内を大気圧に戻す。材料投入口17を 開け、ローラ20を回してボート22を投入口の下まで 移動させ、各ボートに所要の同一あるいは異なる材料を 順次入れる。全てのボート22に材料を入れ終わった ら、排気ポート16から排気システムにより材料供給室 12内を真空排気する。所定の真空度になったら仕切り バルブ11を開けて材料供給室12を真空チャンバ2と 接続する。もしも材料供給室12内に材料のストックを するだけなら、仕切りバルブ11は閉じた状態のままで よい。

【0013】分子線セル1のるつぼ4に材料を供給する とき、伸縮可能の材料供給室12における可動部15を 押し、伸縮機構14を縮めることにより材料供給室を押 縮する。これにより、材料供給室12内の材料搬送機構 18の先端部をるつぼ4の開口部上に位置させる。ロー ラ20を回転させることにより搬送ベルト21を移動さ せ、図1に示すように材料が入ったボート22をるつぼ 4の真上で反転させて材料mをるつぼに落下させ、投入 する。

【0014】上述の実施例では水平方向から、るつぼ4 30 1 分子線セル に材料を搬送、投入するものについて説明したが、図2 (a),(b)に斜め上方からと斜め下方から、るつぼ に材料を入れる実施例についての説明図を示す。これら の実施例にあっては、任意の角度の搬送ベルト21に対 し、黒丸印で示すように、材料を入れるボート22の底 部の固定取付け位置を変更することにより、ボートから 材料がこぼれないようにボートをその搬送時、水平に位 置させている。このように、搬送ベルト21へのボート 22の取付角度を変えることにより、任意の方向からる つぼ4に材料を供給することができ、成膜室に材料供給 40

機構を任意の角度で取付けることができる。

【0015】上述の実施例では分子線セルのるつぼに材 料を供給するものについて説明したが、本発明は、E形 電子銃のるつぼに対しても同様に適用することができ

#### [0016]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成した ので、搬送ベルトに対する材料を入れるボートの取付角 度を変えることにより、任意の方向から成膜室内の所要 ブ11は閉じ、排気ボート16に設けたリークバルブを 10 の箇所に材料を供給することができから、成膜室に材料 供給装置を任意の角度で取付けることが可能となり、成 膜室に多数出ている運転操作用等の他のポートからの制 約を受けずに、材料供給装置を設置することができる。 【0017】材料供給室は仕切りバルブを介して成膜室 に取り付けられているから、同供給室内を真空排気し、 ロードロック状態とすることができ、真空排気下の同供 **給室のボートに材料を入れた状態でストックさせておく** ことが可能となり、成膜室への材料供給を迅速に行うこ とができる。

> 20 【0018】複数のボートに数種の材料を入れておくこ とにより、成膜室を大気圧にリークすることなく、数種 の材料による成膜を連続して行うことができる。

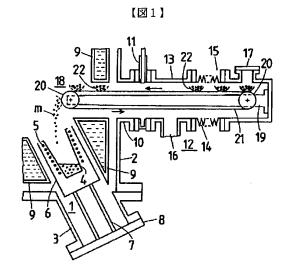
## 【図面の簡単な説明】

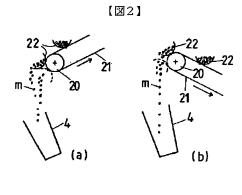
【図1】MBE装置に適用した実施例の断面構成図であ る.

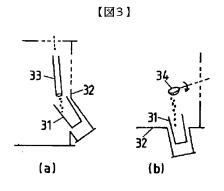
【図2】任意の角度方向から材料を搬送投入する実施例 の説明図である。

【図3】従来の材料供給態様についての説明図である。 【符号の説明】

- - 2 成膜室の真空チャンバ
  - 4 るつぼ
  - 11 仕切りバルブ
  - 12 伸縮可能の材料供給室
  - 14 伸縮機構
  - 17 材料投入口
  - 18 材料搬送機構
  - 21 搬送ベルト
  - 22 材料を入れるボート







DERWENT-ACC-NO: 1995-221683

DERWENT-WEEK: 199529

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Workpiece supply system, for molecular-beam epitaxy equipment - has an expandable workpiece supply chamber coupled to the upper part of the epitaxy equipment through a gate valve

PATENT-ASSIGNEE: NISSHIN ELECTRICAL CO LTD[NDEN]

PRIORITY-DATA: 1993JP-0302173 (November 9, 1993)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES JP 07135177 A May 23, 1995

N/A 004 H01L 021/203

MAIN-IPC

**APPLICATION-DATA**:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE JP07135177A N/A 1993Љ-0302173 November 9, 1993

INT-CL (IPC): C23C014/24; C30B023/08; H01L021/203

ABSTRACTED-PUB-NO: JP07135177A

BASIC-ABSTRACT: An expandable workpiece supply chamber is coupled to the upper port of the epitaxy equipment through a gate valve. Workpiece boats are introduced into the workpiece supply chamber by an endless feed belt.

ADVANTAGE - Workpieces can be supplied from desired directions.

CHOSEN-DRAWING: Dwg. 1/3

TITLE-TERMS:

WORKPIECE SUPPLY SYSTEM MOLECULAR BEAM EPITAXIAL EQUIPMENT **EXPAND WORKPIECE** 

SUPPLY CHAMBER COUPLE UPPER PART EPITAXIAL EQUIPMENT THROUGH **GATE VALVE** 

DERWENT-CLASS: L03 U11

CPI-CODES: L04-D04;

08/09/2002, EAST Version: 1.03.0002

EPI-CODES: U11-C09D;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1995-102226 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1995-173753